

**DEMANDE DE SOUTIEN PAR LA PLATEFORME RENATECH
DU LAAS****Le : 10/05/16****TITRE DU PROJET****Réalisation de masques pour photolithographie****DEMANDEUR****Nom et qualité : Mr CONDE Moustapha R&D Group Manager****Organisme : PHOTONIS France SAS****Secteur d'activité : Vision nocturne****Tutelle :****Institut :****Discipline scientifique :**

Sciences biologiques	Chimie	Ecologie et environnement	Sciences de l'ingénierie	Physique	Sciences de l'univers	Physique Nucléaire
				X		

Adresse : Avenue Roger Roncier, B.P.520, 19106 Brive Cedex, France**N° de téléphone : 05 55 86 38 36****N° de fax : 05 55 86 37 74****Email : m.conde@fr.photonis.com****Contact au LAAS (éventuellement) : Mme Chantal Fontaine**

1/4

DEMANDE DE SOUTIEN PAR LA PLATEFORME RENATECH DU LAAS

CONTEXTE SCIENTIFIQUE DU PROJET (5 A 10 LIGNES MAX)

Réalisation de masques de photolithographie pour des procédés de métallisation de détecteurs à base de matériaux III/V

OBJECTIFS SCIENTIFIQUES DU PROJET (5 A 10 LIGNES MAX)

Réaliser un jeu de deux masques correspondant aux designs fournis par Photonis

Début souhaité des travaux : **10/06/16**

Cadre institutionnel du projet : projets ANR, conseil régional, Europe, autres, ...

PERSONNE ACCUEILLIE AU LAAS-CNRS LE CAS ECHEANT

Nom et qualité : Mr

Organisme :

Adresse :
N° de téléphone :
N° de fax :
Email :

Évaluation des connaissances de la technologie nécessaires à la réalisation prévue :

Théoriques :

Pratiques :

Commentaires :

DEMANDE DE SOUTIEN PAR LA PLATEFORME RENATECH DU LAAS

NATURE DES TRAVAUX

Micro et nano électronique	Photonique	MEMS/NEMS/ MOEMS/Acoustique	Micro- nano pour la bio	Simulation/ Instrumentation	Autres
NC	NC	NC	NC	NC	X

PROCEDES

Description des étapes du(es) procédé(s) dans l'ordre prévisible

RESSOURCES SOLLICITEES	<input checked="" type="checkbox"/> Lithographie laser (fabrication de masque)	<input type="checkbox"/> EJM
	<input type="checkbox"/> Photolithographie UV	<input type="checkbox"/> Implantation ionique
	<input type="checkbox"/> Lithographie électronique	<input type="checkbox"/> Fours
	<input type="checkbox"/> Chimie	<input type="checkbox"/> Nano imprint
	<input type="checkbox"/> Electrochimie	<input type="checkbox"/> Jet d'encre
	<input type="checkbox"/> Dépôts PVD	<input type="checkbox"/> Assemblage
	<input type="checkbox"/> Gravure plasma	<input type="checkbox"/> Séchage supercritique
	<input type="checkbox"/> Gravure humide (KOH/TMAH)	<input type="checkbox"/> Caractérisation

3/4

**DEMANDE DE SOUTIEN PAR LA PLATEFORME RENATECH
DU LAAS****VERROUS IDENTIFIES**

Etapas nécessitant un développement technologique, ou l'adaptation d'un équipement, ou tributaires de ressources fournies par un partenaire

VOLUME

Nombre de plaques à traiter et nombre de runs.

2 masques à réaliser (voir designs joints)

Si la demande de réalisation est susceptible d'être renouvelée au cours de développements ultérieurs du projet, donnez une estimation du cycle :

AUTRES REMARQUES**DEMANDE ADRESSEE A D'AUTRES CENTRALES RTB :**
(SI OUI PRECISER LAQUELLE)